

The Delphion Integrated View

Other Views: INPADOC | Derwent...

Title: JP6071425A2: OPTICAL BEAM HEATING METHOD

➤ Want to see a more descriptive title highlighting what's new about this invention?

Country: JP Japan

Kind: A (See also: JP6071425B4)

Inventor(s): SHIRAISHI KEIYA

**KOBAYASHI MAKOTO** 

Applicant/Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Issued/Filed Dates: March 15, 1994 / Aug. 31, 1992

> Application JP1992000230953 Number:

IPC Class: B23K 1/005; G02B 6/04; G02B 6/32; G02B 27/10; H05K 3/34;

Interested in classification by use rather than just by description?

Priority Number(s): Aug. 31, 1992 JP1992000230953

Abstract: Purpose: To provide an optical beam heating method, by which local heating in small range can be executed and heating speed is quickened with high efficiency, by making the irradiating diameter of the optical beam small and the irradiating energy high.

Constitution: The irradiating optical beam from a luminous lamp, such as a xenon lamp, is condensed by a reflecting mirror, such as elliptic mirror, and a bundle optical fiber 4 is arranged at the focus point 2 in this reflecting mirror or the neighborhood thereof. This optical fiber is divided into two or more between an incident end and an outgoing end of the optical beam and lens mechanism 9, 10 are arranged at the outgoing end of each divided optical fiber 7, 8. This each focus point of the lens is concentrated to the position expected to heat a heated body 13 for locally soldering or locally heating to the other aim to execute the irradiation. By making the optical beam irradiating diameter at the focus point of the lens small and the energy density high, the local heating in the range limited to smaller can be executed to widen the applying range, and the heating speed is quickened to make this operation the high efficiency. COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

See a clear and precise summary of the whole patent, in understandable terms.





Inquire Regarding Licensing

# 特開平6-71425

(43)公開日 平成6年(1994)3月15日

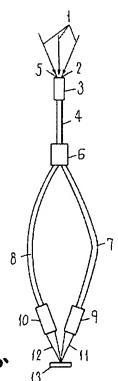
技術表示簡別	FΙ	庁内整理番号	別記号	4		(51)Int.Cl. <sup>5</sup>
		8727-4E	В		1/005	B 2 3 K
			E		6/04	G 0 2 B
		7132-2K			6/32	
		8106-2K			27/10	
		9154-4E	Т		3/34	H 0 5 K
客査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁	ā					
000005821	(71)出願人		-230953	特願平4	ļ	(21)出願番号
松下電器産業株式会社						
大阪府門真市大字門真1006番地		31日	(1992) 8月	平成4年		(22)出願日
白石 圭哉	(72)発明者					
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器						
産業株式会社内						
小林 誠	(72)発明者					
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器						
産業株式会社内						
弁理士 小鍜治 明 (外2名)	(74)代理人					

## (54) 【発明の名称】 光ピーム加熱方法

#### (57)【要約】

【目的】 光の照射径を小さくし、照射エネルギー密度 を高めて、小さい範囲での局部加熱が可能とし、かつ加 熱速度を速くして高能率にする光ビーム加熱方法を提供 する。

【構成】 キセノンランプなどの発光ランプから放射さ れた光を、楕円鏡などの反射鏡により集光し、この反射 鏡の集光点2あるいはその近傍にパンドル光ファイバー 4を設け、この光ファイバーを少なくとも入射端と出射 端との間で2分岐以上に分岐し、分岐された各々の光フ ァイバー7,8の出射端にレンズ機構9,10を設け、 この各々のレンズの集光点を局部はんだ付けあるいは他 の局部加熱する被加熱体13の加熱しようとする部位に 集中させて照射し、レンズの集光点での光照射径を小さ くしかつエネルギー密度を高め、より小さく限定された 範囲での局部加熱を可能として適用範囲を広め、かつ加 熱速度を速くして高能率にする。



BEST AVAILABLE COP'

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】発光源から放射された光を、反射鏡により 集光し、この集光点あるいはその近傍に光ファイバーの 入射端を設け、光ファイバーの出射端にレンズ機構を設 け、このレンズの集光点あるいはその近傍にて被加熱体 を加熱して、はんだ付けあるいは他の加熱を行う方法に おいて、前記光ファイバーを少なくとも2分岐以上に分 岐し、分岐された各々の光ファイバーの出射端にレンズ 機構を設け、この各々のレンズの集光点をはんだ付けあ るいは他の加熱する被加熱体の加熱しようとする部位に 10 集中させることを特徴とする光ビーム加熱方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子部品やプリント基板 の局部はんだ付けの自動化を行う場合の加熱方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来はキセノンランプなどの発光ランプから放射された光を、楕円鏡などの反射鏡により集光し、この反射鏡の集光点あるいはその近傍に光ファイバ 20一の入射端を設け、光ファイバーの出射端にレンズ機構を設け、このレンズの集光点あるいはその近傍にて被加熱体を局部的に加熱して、局部はんだ付けあるいは他の局部加熱加工を行っていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の構成では、きわめて限定された部位を加熱加工する場合、細い径の光ファイバーを使おうとすると、光エネルギーは光ファイバーの径に比例するため十分な光エネルギーが得られず、加熱に時間を要するという問題点が 30 あった。

【0004】本発明は上記従来の問題点を解決するもので、レンズの集光点での光照射径を小さくしかつエネルギー密度を高め、これにより、より小さく限定された範囲での局部加熱を可能として適用範囲を広め、かつ加熱速度を速くして高能率化をはかることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明の光ビーム加熱方法は、キセノンランプなどの発光ランプから放射された光を、楕円鏡などの反射鏡に 40 より集光し、この反射鏡の集光点あるいはその近傍に光ファイバーの入射端を設け、この光ファイバーの出射端にレンズ機構を設け、このレンズの集光点あるいはその近傍にて被加熱体を局部的に加熱して、局部はんだ付けあるいは他の局部加熱を行う方法において、前記光ファイバーを少なくとも入射端と出射端との間で2分岐以上に分岐し、分岐された各々の光ファイバーの出射端にレンズ機構を設け、この各々のレンズの集光点を局部はんだ付けあるいは他の局部加熱する被加熱体の加熱しようとする部位に集中させて照射する構成を有している。50

[0006]

【作用】前記したように、キセノンランプなどの発光ラ ンプから放射された光を、楕円鏡などの反射鏡により集 光し、この反射鏡の集光点あるいはその近傍に光ファイ パーの入射端を設け、この光ファイパーの出射端にレン ズ機構を設け、このレンズの集光点あるいはその近傍に て被加熱体を局部的に加熱して、局部はんだ付けあるい は他の局部加熱を行う場合、レンズの集光点での光照射 径は、光ファイパーの出射端での径とレンズ機構とによ って決まる。レンズの集光点での光照射径を小さくする には光ファイバー径を小さくしレンズ機構を縮小光学系 にすればよい。しかし、光ファイパー径を小さくする と、光ファイバーの入射部での光エネルギー密度が光フ ァイバー径に関係なく決まっているので、光ファイバー に入射される光エネルギー量が減少し、加熱能力が低下 してしまう。また、レンズ機構を縮小光学系の縮小度合 いを大きくすると、レンズの集光点での光照射径を小さ くできるが、ここでのエネルギー損失が増大し、レンズ の集光点での光照射径内に照射される光エネルギー量は 減少する。

2

【0007】本発明では、数百本の光ファイバー素線よりなり比較的大きな入射端径のバンドル光ファイバーを、その入射端と出射端との間で少なくとも2分岐以上に分岐し、分岐された各々の光ファイバーの出射端の径を入射端の径よりも大幅に小さくし、この分岐され小さくなった径の光ファイバー出射端に各々レンズ機構を設け、この各々のレンズの集光点を局部はんだ付けあるいは他の局部加熱する被加熱体の加熱しようとする部位に集中させて照射することにより、照射される光エネルギー量を減少させずに照射径を小さくでき、被照射部位での光エネルギー密度を高めうる。

[0008]

【実施例】以下本発明の一実施例について、図面を参照 しながら説明する。

【0009】図1において、1はキセノンランプなどの発光ランプから放射された光を、楕円鏡などの反射鏡により集光した光であり、反射鏡の集光点2に集光されている。3は数百本のファイバー素線を束ねたバンドル光ファイバー4の入射端であり、その端面5が反射鏡の集光点2にほぼ一致させてある。6はバンドル光ファイバーの分岐点であり、図1では2分岐の場合を示している。7と8は分岐された後の細くなった分岐バンドル光ファイバーであり、分岐前のバンドル光ファイバー4の径をDとし分岐バンドル光ファイバー7および8の径をdとし、分岐数をnとすると、

 $d = D \cdot n^{-1/2}$ 

となる。

【0010】例えば、2分岐したとすれば分岐後の径は 分岐前の径の1/1.41となる。9および10は分岐 50 パンドル光ファイパー7,8の出射端に取りつけられた (3)

3

レンズ機構であり、分岐パンドル光ファイバー7、8の 出射端面とレンズの位置を調節可能とし、縮小光学系の 縮小度合いをおよそ1/0.9~1/2.1の範囲で調 節できるようにしてある。

【0011】分岐パンドル光ファイバー7,8の出射端 面からレンズ機構9,10のレンズまでの距離を大きく すれば縮小度合いを大きくできるが、分岐バンドル光フ ァイパーによって導かれた光はその光ファイバー固有の 開口角で発散するので、この距離を大きくしすぎると発 散してレンズに入らない光の比率が大きくなり、これに 10 伴い損失が増えるので、縮小度合いを大きくするにもお のずから限度がある。

【0012】11,12はレンズ機構9,10から照射 される光であり、この各々のレンズの集光点を局部はん だ付けあるいは他の局部加熱する被加熱体13の加熱し ようとする部位に集中させて照射する。

【0013】図2は被加熱体13への光照射の様子を示 した一例の詳細図である。14は被加熱体13がプリン ト基板の場合にプリント基板上に設けられた銅箔15と はんだ付けしようとするリードであり、レンズ機構9, 10から照射される光11,12の集光点を局部はんだ 付けしようとする被加熱体13の加熱しようとする部位 16に集中させて照射する。

【0014】例えば、従来、3.2mmのパンドル光ファ イパーを用いた場合、被加熱体13への照射径はの3. 5mm~φ1.5mmとなり、照射径をφ1.5mmと小さく すると照射エネルギーは約30%~40%がレンズ機構 での損失となって失われていた。

【0015】しかし、一方ではプリント基板のファイン パターン化が進み、 φ1. 5 mmの 照射径では 銅箔 15 の 30 9, 10 レンズ機構 ランド径をはみだして光を照射してしまう危険性があっ た。銅箔15のランド径をはみだして光を照射してしま うと、樹脂やガラス繊維からなるプリント基板の素材は 銅に比して熱伝導度が極めて悪いので、熱が容易に蓄積 され温度が急速に上昇してついに焼損にいたる。

【0016】本発明では、この光の照射径を光ファイバ ーの2分岐により

 $\phi 1.5 \text{ mm} / 1.41 = \phi 1.06 \text{ mm}$ として小さな径にできるので、ファインパターンのプリ ント基板に対してもプリント基板の焼損の恐れがなく適 用可能となり、かつ図2のレンズ機構9、10から照射 される光11,12を重ねて照射することにより照射エ ネルギー密度を約2倍に高めて能率よく加熱することが できる。

#### [0017]

【発明の効果】本発明により、レンズの集光点での光照 射径を小さくしかつ照射エネルギー密度を高めることが できるので、より小さく限定された範囲での局部加熱が 可能となり、非接触の局部はんだ付け自動化用熱源など の局部加熱用熱源としての適用範囲を広め、かつ加熱速 度を速くして高能率化を達成することができる。

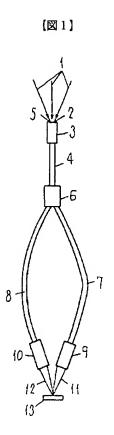
### 【図面の簡単な説明】

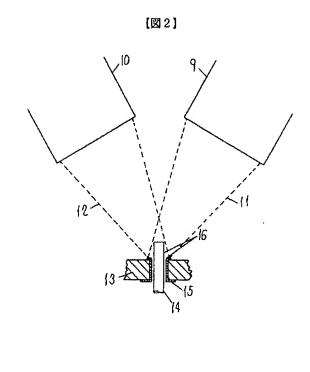
【図1】本発明の一実施例における光ビーム加熱方法の 説明図

【図2】本発明の一実施例における光照射の様子を示し た詳細図

#### 【符号の説明】

- 1 ランプからの光を、集光した光
- 2 集光点
- 3 入射端
- 4 パンドル光ファイバー
- 5 端面
- 6 分岐点
- 7,8 分岐パンドル光ファイパー
- 11, 12 レンズ機構9, 10から照射される光
- 13 被加熱体
- 14 リード
- 15 銅箔
- 16 加熱しようとする部位





BEST AVAILABLE COP'